

課題番号 : F-21-KT-0042
利用形態 : 機器利用
利用課題名(日本語) : 構造的媒質と高強度レーザーとの相互作用による準定常強磁場生成の検証-1
Program Title (English) : Generation of quasi-static magnetic field by the interaction between a high-power laser and structured medium-1
利用者名(日本語) : 岸本泰明、松井隆太郎、上原直希、山田伊織
Username (English) : Yasuaki Kishimoto, Ryutaro Matsui, Naoki Uehara, Iori Yamada
所属名(日本語) : 京都大学大学院 エネルギー科学研究科
Affiliation (English) : Graduate School of Energy Science, Kyoto University
キーワード/Keyword : リソグラフィ・露光・描画装置、エッチング、ロッド集合体

1. 概要(Summary)

直径サブ μm で長さが数十 μm オーダのロッド群と背景ガスからなる媒質(構造的媒質)に高強度レーザーを照射することで、ロッドと背景ガスが接触する領域に無衝突プラズマ境界層が形成される。そこでのダイナミクスを通じて、無衝突衝撃波による高エネルギーイオンの生成、キロテスラ級準定常強磁場による高エネルギー粒子の閉じ込め、といった多彩な非線形現象が創出されることが理論・粒子シミュレーションにより明らかにされている。本研究では、これらの現象を解明するため、世界最高クラスの高強度レーザー(量研関西研・J-KAREN-P)を照射する実験に向けて、シリコンウエハのドライエッチング技術(ボッシュプロセス)を用いて、直径がサブ μm オーダのケイ素の準2次元のロッド集合体を作製し、これに背景ガスを導入することで構造的媒質を準備する。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

レーザーダイシング装置、電子線蒸着装置、大面積超高速電子線描画装置、磁気中性線放電ドライエッチング装置、深堀りドライエッチング装置 2

【実験方法】

レーザーダイシング装置によりシリコンウエハから30mm 角に切り出したシリコン基板を用いて、ウエハスピンド洗浄装置により洗浄を行った後、電子線蒸着装置を用いてクロムの蒸着を行った。厚膜フォトリソ用スピンドコーティング装置を用いてレジストを塗布した後、大面積超高速電子線描画装置を用いて電子線リソグラフィにより基板上にパターンを描画した。パターンは CAD により設計し、直径サブ μm オーダの円が μm オーダの等間隔で規則的に配置した。描画後、レジスト現像装置により現像

を行ってパターン部分を保護し(ネガ型レジスト)、磁気中性線放電ドライエッチング装置によるクロムのエッチング、および深堀りドライエッチング装置によるシリコンのプラズマエッチングを実施した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

電子線リソグラフィにおける dose 量に関する最適化を行い、直径サブ μm オーダの円が μm オーダの間隔で多数配置された構造の精緻な描画に成功した。また、深堀りエッチング時の印加電圧を調整することで、高アスペクト比(高さ/直径 ~ 40 -100)のロッド集合体を安定して作製する手法を確立した。

4. その他・特記事項(Others)

・参考文献:[1] 岸本泰明, 松井隆太郎, 深見一弘, 坂口浩司, 福田祐仁, 今寺賢志, 「高強度レーザーと構造的ターゲットとの相互作用による高エネルギー密度プラズマ生成とその特性① —背景の物理と展開—」、日本物理学会 2020 年秋季大会、2020. 9. 8、online [2] 岸本泰明, 松井隆太郎, 増井英陽, 今寺賢志, 「高強度レーザー駆動の相対論プラズマの凍り付きと非断熱的な無衝突衝撃波構造の形成」、第 37 回プラズマ・核融合学会年会、2020. 12. 2、online

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許(Patent)

なし